

《参考》 排出基準（大気排出基準、水質排出基準）

大気基準適用施設及び水質基準適用事業場に係る排出基準は次のとおりです。

■ 排出ガスに係る排出基準（大気排出基準）

（単位：ng-TEQ/m³N）

	特定施設の種類（大気基準適用施設）	排出基準		
		既設施設基準	新設施設基準	
1	銑鉄製造用焼結炉	1	0.1	
2	製鋼用電気炉	5	0.5	
3	亜鉛回収施設	10	1	
4	アルミニウム合金製造施設	5	1	
5	廃棄物焼却炉（火床面積が 0.5 m ² 以上又は焼却能力が 50kg/h 以上）	4t/h 以上	1	0.1
		2t/h 以上 4t/h 未満	5	1
		2t/h 未満	10	5

注)既設施設基準は平成12年1月15日以前に設置された特定施設について適用。ただし、大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉（火格子面積が2 m²以上又は焼却能力が200kg/h 以上）及び製鋼用電気炉については、新設施設基準が適用される。

■ 燃え殻・ばいじんの処理基準

（単位：ng-TEQ/g）

特定施設の種類	処理基準
廃棄物焼却炉	3

注)平成12年1月15日以前に設置した施設であって、セメント固化等の処理をする場合には、この処理基準は適用しない。

■排水に係る排出基準（水質排出基準）

（単位：pg-TEQ/L）

	特定施設の種類（水質基準対象施設）	排出基準
1	硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
5	担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	
7	カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設	
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設	
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設	
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設	
11	ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	
13	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	
14	担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設	
15	廃棄物焼却炉（火床面積が0.5m ² 以上又は焼却能力50kg/h以上）に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設	
16	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設	
17	フロン類（CFC及びHCFC）の破壊（プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	
18	水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設	
19	1 から17 までの施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	